

04; 11

(C) 1992

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА КИРКЕНДАЛЛА НА ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ

К.А. Т у р с у н м е т о в

Стабильность и долговечность работы систем $\text{Me}-\text{O}-\text{Cs}$ и $\text{Me}-\text{O}-\text{Ba}$, использующихся в термоэмиссионных преобразователях энергии (ТЭП), в основном зависит от термостойкости окислов металлов и от содержания кислорода в металле [1, 2]. До сих пор эти факторы не учтены, поэтому нами были сформулированы новые требования к материалам электродов ТЭП [1].

Из анализа физико-технических свойств металлов, проведенного на основе этих требований, видна перспективность использования в ТЭП следующих металлов: Ta , Nb , Ti , Zr и Hf .

Эмиссионные свойства системы $\text{Ta}-\text{O}-\text{Cs}$ изучены в [3], где показано, что минимальная работа выхода системы составляет ~ 1.3 эВ.

Эмиссионные свойства кислородсодержащего поликристаллического ниобия в потоках атомов цезия были изучены в [4, 5] и было показано, что минимальное значение работы выхода системы $\text{Nb}-\text{O}-\text{Cs}$ равно 1.4 эВ. Однако это противоречит результатам работ [6, 7], в которых показано, что минимальные значения работы выхода системы $\text{Nb}-\text{O}-\text{Cs}$ составляют 1.11–1.25 эВ.

Эмиссионные свойства чистого и окисленного титана и циркония изучены в [8–11]. Было установлено, что минимальное значение работы выхода системы $\text{Ti}-\text{Cs}$ равно 1.60–1.65 эВ при $T = 660$ – 680 К, а системы $\text{Zr}-\text{Cs}$ – 1.60–1.70 эВ при $T = 600$ – 610 К соответственно. После окисления их минимальные значения работы выхода составляют 1.40–1.50 эВ, что значительно выше работы выхода систем $\text{W}-\text{O}-\text{Cs}$ и $\text{Mo}-\text{O}-\text{Cs}$. Аналогичные исследования проводились нами для Hf и нами получены высокие значения работы выхода этих систем по сравнению с $\text{W}-\text{O}-\text{Cs}$ и $\text{Mo}-\text{O}-\text{Cs}$, что связывается с образованием трехмерных (объемных) окислов [8, 9].

Атомы кислорода, находясь в октапорах ГПУ решетки [12], образуя объемные окислы [13], не очень сильно изменяют эмиссионные и адсорбционные свойства Ti , Zr и Hf . Окисление приводит к уменьшению работы выхода этих металлов в потоке (в парах) атомов цезия на 0.15–0.20 эВ, а также к увеличению теплоты адсорбции атомов цезия на них на $0.15 + 0.05$ эВ. Такие же закономерности наблюдались для системы $\text{Ti}-\text{O}-\text{Ba}$, $\text{Zr}-\text{O}-\text{Ba}$, $\text{Hf}-\text{O}-\text{Ba}$. При окислении этих металлов (при $T > T_{\alpha \rightarrow \beta}$ [12, 13]) β -фаза не сохраняется и образуются объемные (трехмерные) окис-

лы со сложной структурой [13]. Работа выхода системы на уровне 1.2 эВ не достигается, так как атомы кислорода, находясь в октаэдрических порах, при адсорбции атомов цезия или бария создают поляризованный слой с относительно малым дипольным моментом. Поэтому работа выхода окисленных металлов в потоке атомов цезия со структурой ГПУ решетки выше, чем окисленных металлов со структурой решетки ОЦК или ГЦК.

В связи с этим сделана попытка получения субмонослоиной пленки этих металлов со структурой ОЦК на поверхности тугоплавких металлов. Были изготовлены сплавы металлов на основе Nb , Ta и W . Согласно эффекту Киркендалла, в процессе термического обезгаживания этих сплавов в вакууме на поверхность выходят атомы легкоплавящихся компонентов и возможно образование пленки из этих атомов [12, 16]. Помимо этого, введение атомов циркония, гафния и титана в тугоплавкие сплавы должно изменить следующие свойства системы:

1. Существенно повысить растворимость кислорода в металле [17].
2. Значительно повысить активность к кислороду атомов этих металлов, находящихся на поверхности тугоплавких металлов.
3. Образовать более термостойкие окислы этих металлов на поверхности сплава по сравнению с окислами тугоплавких металлов [18].
4. Образовать двумерные (не объемные) окислы, которые аналогичны системам $W-O-Cs$ и $Mo-O-Cs$ в случаях образования пленок этих металлов на поверхности со структурой ОЦК и ГЦК решетки. Это должно увеличить результирующий дипольный момент двойного поляризованного слоя.

Учитывая выше изложенное, нами были исследованы сплавы вольфрама, тантала и ниobia с 1, 3, 10 ат. % графия [19] и сплавы с 1, 3, 10 ат. % циркония [20-21]. После термического обезгаживания в вакууме $p < 1 \cdot 10^{-7}$ Тор прогревом до 2000–2100 К и после стабилизации работы выхода изучалась термоэлектронная эмиссия сплавов в потоке атомов цезия. Минимальные значения работы выхода в потоках атомов цезия ($\gamma = 1.10^{11} - 1.10^{14}$ ат./ $cm^2 \cdot с$) для сплава $Nb-Hf$ (1 и 3 ат. %) составляли 1.52–1.58 эВ при $T = 620$ –630 К, для сплава $W-Hf$ (1 и 3 ат. %) – 1.39–1.48 эВ при $T = 600$ –615 К и для сплава $Ta-Hf$ (1 и 3 ат. %) – 1.46–1.50 при $T = 645$ –655 К [19].

Окисление сплавов проводилось при температурах $T = 1000$ –1600 К в течение 15–30 мин в атмосфере кислорода при его давлениях $(5-50) \cdot 10^{-6}$ Тор. Самые минимальные значения работы выхода этих сплавов после окисления и термоотжига (содержание гафния 1 и 3 ат. %) в потоке атомов цезия составляли соответственно для $Nb-Hf$ 1.40 эВ, для $W-Hf$ – 1.29 эВ и для $Ta-Hf$ – 1.20 эВ.

В случаях, когда содержание гафния в сплавах составляло 10 ат. %, эмиссионные свойства системы сплав гафния–цеций были аналогичны эмиссионным свойствам системы гафний–цеций.

Аналогичные исследования проводились и для сплавов циркония. При содержании циркония 1 и 3 ат. % минимальные значения работы выхода в потоке атомов цезия составляли для сплава $W-Zr$ 1.65–1.70 эВ при $T = 640$ –650 К, для сплава $Ta-Zr$ – 1.45–1.50 эВ при $T = 680$ –690 К, а для сплава $Nb-Zr$ 1.36–1.40 эВ при $T = 630$ –650 К [20–21]. После окисления при различных температурах ($T = 1000$ –1600 К) и при давлениях кислорода $(5\text{--}50) \cdot 10^{-6}$ Тор в течение 15–30 мин и после термоотжига в вакууме из S -образных кривых определялись минимальные значения работы выхода, которые уменьшались до 1.45 эВ, 1.32 и 1.20 эВ соответственно.

При более высоких концентрациях (10 ат. %) циркония и гафния в сплавах Ta , Nb и W на поверхности, по-видимому, образуется более толстая пленка циркония и гафния. Поэтому эмиссионные свойства этих сплавов почти аналогичны эмиссионным свойствам системы $Zr-O-Cs$ и $Hf-O-Cs$. Анализы экспериментальных результатов показывают, что однородная субмонослоистая пленка гафния образуется на поверхности сплава Ta с 1 и 3 ат. % Hf , а субмонослоистая пленка циркония на поверхности сплава Nb с 1 и 3 ат. % Zr . Доказательством этого предположения являются следующие факты:

1. На вольтамперных характеристиках, снятых после обезгаживания этих сплавов в вакууме и после стабилизации работы выхода при $T < 1700$ К, не наблюдается аномальный эффект Шоттки.

2. Не наблюдаются дополнительные максимумы или „седлообразные“ формы S -образных кривых, снятых после обезгаживания и после окисления.

3. Образование однородной субмонослоистой пленки со структурой подложки (ОЦК) позволяет получить работу выхода в потоке атомов цезия ~ 1.2 эВ.

Образование пленки легкоплавляющейся компоненты на поверхности сплавов происходит по-разному. Например, для сплава $Nb-Hf$ реализуется островковый рост пленки гафния на поверхности сплава. Об этом свидетельствуют наличие аномального эффекта Шоттки, наблюдение „седлообразной“ формы на S -образной кривой в потоке атомов цезия [22] и наши наблюдения недостаточно тренированного сплава ниобия с цирконием, наличие заметной интенсивности Оже-спектров ниобия при контроле поверхности элементного состава поверхности сплава. В остальных случаях при низких температурах ($T < 1500$) наблюдается послойный рост пленки циркония или гафния на поверхности сплавов. Однако при относительно более высоких температурах атомы циркония и гафния подвижны [23], эпитаксиальность пленки не сохраняется и возможно образование лабиринтной структуры пленки с последующим формированием островков, т.е. нарушением „двумерности“ пленки циркония или гафния [23].

Если анализировать эти данные с точки зрения образования металлических пленок [15, 16], то при сильной связи адсорбированного атома с адсорбатом реализуется послойный рост пленки, при слабой связи реализуется островковый рост пленки, а при промежу-

точном — механизм Странского-Крастанова. Учитывая, что температура плавления характеризует энергию кристаллической решетки, были сопоставлены температуры плавления компонент сплавов и их эмиссионные свойства. В случаях, когда отношения температуры плавления легкоплавящейся компоненты T_L к температуре плавления тугоплавкого металла подложки T_t , т.е. $T_L/T_t < 0.75$ (или $3/4$), происходит послойный рост пленки легкоплавящейся компоненты (по эффекту Киркендалла), однако целостность (однородность) и эпитаксиальность пленки не сохраняется при более высоких температурах, что подтверждается экспериментами. В случаях $T_L/T_t > 0.75$ при прогреве сплава в вакууме на его поверхности идет островковый рост пленки атомов легкоплавящихся компонент и только при больших концентрациях (10% и более) последней, возможно, растут островки в виде плоских образований или сферической формы с последующим образованием пленки со структурой, отличающейся от структуры подложки.

В промежуточном значении $T_L/T_t = 0.75 \pm 0.02$ (или $3/4$), по-видимому, рост пленки происходит в соответствии с принципом Странского-Крастанова и при концентрациях 1–3 ат.% легкоплавящихся компонент возможно образования субмонослоевой пленки последней.

Анализ на основе этого критерия и вышеизложенных требований показывает, что из периодической системы элементов Менделеева, к нему удовлетворяют сплавы $Nb-Zr$, $Ta-Hf$, $W-Nb$ и $Mo-Zr$. Такой критерий подтверждается многими системами металлов, которые не используются в качестве эмиссионных материалов. Например, для системы $Mo-Cr$ [24], $Pb-Cu$ [25] и др. Следует отметить, что наличие на поверхности сплава кислорода и углерода может изменить положение. Например: в случае окисленных $W-Hf$ и $Ta-Zr$ не достигается высокая однородность окисленной пленки легкоплавящейся компоненты. Однако высокотемпературные прогревы окисленного сплава, по-видимому, приводят к упорядочению двумерного окисного слоя легкоплавящейся компоненты, и работа выхода в потоке атомов цезия уменьшается дополнительно еще на 0.2 эВ. При изготовлении одной партии сплава $Mo-Zr$ допущено загрязнение образца заметной концентрацией углерода, как это было показано методом Оже-спектроскопии. До существенной очистки поверхности от углерода не получались „колонообразная“ форма S -образных кривых и минимальное значение работы выхода 1.2 эВ для окисленного при различных режимах сплава в потоке атомов цезия.

Таким образом, в случаях изготовления сплава из двух компонентов металлов: тугоплавкого и легкоплавящегося кислородоактивного с содержанием 1–3 ат.%, подобранных так, что отношение температуры плавления легкоплавкого T_L к температуре плавления тугоплавкого T_t металла равно $3/4 \pm 0.02$ и последующим нагреванием сплава в вакууме до стабилизации работы выхода достигается получение на поверхности однородной пленки атомов легкоплавящейся компоненты со структурой типа структуры подложки. Окисле-

ние в атмосфере кислорода таких систем позволяет, по-видимому, получить двумерные окислы на поверхности, а в потоке атомов цезия достичь минимальной работы выхода системы на уровне 1.2 эВ.

Автор благодарит Б.Ч. Дюбуа, О.К. Култашеву и А. Макарову за помощь в проведении экспериментов и Н.А. Горбатый за обсуждение результатов эксперимента.

Список литературы

- [1] Азизов У.В., Турсунметов К.А., Сабиров А.К. Тез. докл. конф. по непосредственному преобразованию тепловой энергии в электрическую. М. 1984. С. 24.
- [2] Ушаков Б.А., Никитин В.Д., Емельянов И.Я. Основы термоэмиссионного преобразования энергии. Л. 1978. С. 169-198.
- [3] Саттаров Х.М., Абдуллаев Р.М. // Физическая электроника. Сб. науч. тр. ТашГУ. Ташкент, 1987. С. 62-65.
- [4] Гвардицели И.Г., Менабде Н.Е., Цахадзе А.М. Тез. докл. ХУП Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. Л. 1978. С. 196-198.
- [5] Алейников И.Н. и др. Тез. докл. конф. по непосредственному преобразованию тепловой энергии в электрическую. М. 1984. С. 36.
- [6] Зыков Б.М. и др. Тез. докл. ХУШ Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. М.: Наука, 1981. С. 117-118.
- [7] Клименко Е.В. Тез. докл. ХУШ Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. М.: Наука, 1981. С. 131-132.
- [8] Цхакая В.К., Ярыгин В.И. // ЖТФ. 1980. Т. 50. В. 5. С. 957-962.
- [9] Цхакая В.К., Ярыгин В.И., Чилингарашивили Р.С. // ЖТФ. 1982. Т. 52. В. 5. С. 93-941.
- [10] Азизов У.В., Турсунметов К.А., Сабиров В.К. Тез. докл. XIХ Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. Т. 1. Ташкент, ФАН: 1984. С. 126.
- [11] Турсунметов К.А., Сабиров А.К. // Физическая электроника. Сб. науч. тр. ТашГУ. Ташкент, 1987. С. 65-69.
- [12] Григорович В.К. Металлическая связь и структура металлов. М.: Наука, 1988. 242 с.
- [13] Корнилов Н.Н., Глазова В.В. Взаимодействие металлов переходных групп с кислородом. М.: Наука, 1967. 245 с.
- [14] Физическое металловедение. Т. 1. М.: Мир. С. 246.
- [15] Палатник Л.С., Фукс М.Я., Косевич В.М. Механизм образования и структура конденсированных пленок. М.: Наука, 1972. 320 с.
- [16] Трусов Л.И., Холмянский В.А. Островковые металлические пленки. М.: Металлургия, 1973-321 с.

- [17] Окисление металлов/ Под ред. Бенара Ж.М. Т. 11. ИЛ, 1969. 448 с.
- [18] Казенас Е.К., Чижиков Д.М. Давление и состав пара над окислением химических элементов. М.: Наука, 1976. 342 с.
- [19] Турсунметов К.А., Сабиров А.К., Азизов У.В. Тез. докл. XX Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. Т. 1. Киев, 1987. С.126.
- [20] Турсунметов К.А., Сабиров А.К., Эргашев Ж.Н. Тез. докл. XXI Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. Т. 1 Л. 1990. С. 223.
- [21] Турсунметов К.А., Сабиров А.К., Эргашев Ж.Н. // Изв. АН СССР. Сер. Физическая. 1991. В. 12. С. 2353-2356.
- [22] Холов А. и др. Тез. докл. XIX Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. Т.1 Ташкент: ФАН. 1984. С. 128.
- [23] Проблемы современной кристаллографии. М.: Наука, 1975. С. 150-171.
- [24] Владимиров Г.Г., Магкоев Т.Т., РумиГ.А. Поверхность. Физика. Химия. Механика. 1990. В. 5. С. 20-25.
- [25] Oral B., Ycock R.W. // J. Vac. Sci and Technol. A. 1990. V. 8. N 3. P. 3048-3051.

Поступило в Редакцию
23 апреля 1992 г.